

放射線装置関連機器分類表

		区分（学内規程）	区分（電離則）	区分（RI規制法）
[1] エックス線装置 定義 高電圧により電子を加速しこれをタングステンなどのターゲットに当ててエックス線を発生させる装置				
医療用 (医療での利用に限定) 工業用等 (上記以外の全て、研究用)	定格出力 電圧 (1MV以上) 10kV以上 1MV未満 10kV未満	→ [2] → エックス線等装置 エックス線装置 → 管理対象外 (自主管理)	放射線装置 エックス線装置 対象外	対象外
[2] 荷電粒子を加速する装置 放射線発生装置 定義 なし 定義 RI規制法で定義されている放射線発生装置				
[装置型] サイクロトロン シンクロトロン シンクロサイクロトロン 直線加速装置 ベータトロン ファン・デ・グラフ型加速装置 コッククロフト・ワルトン型加速装置 その他 変圧器型加速装置 マイクロトロン プラズマ発生装置	エネルギー 表面線量 1MeV以上 600nSv/hを超える 600nSv/h以下	→ 放射線発生装置 (RI規制法) 荷電粒子を加速する装置 放射線発生装置 → エックス線等装置 荷電粒子を加速する装置 イオン加速装置	放射線装置 荷電粒子を加速する装置 放射線装置 荷電粒子を加速する装置	放射線発生装置 対象外
イオンを加速する装置 集束イオンビーム装置	30kVを超え, 1MeV未満 表面線量 600nSv/hを超える 600nSv/h以下 30kV以下	→ エックス線等装置 荷電粒子を加速する装置 イオン加速装置 → 粒子加速装置 その他 → 管理対象外 (自主管理)	放射線装置 荷電粒子を加速する装置 対象外	対象外
付随的に発生する装置	表面線量 600nSv/hを超える 600nSv/h以下	→ エックス線等装置 → 管理対象外 (自主管理)	対象外	
[3] 電子顕微鏡 定義				
透過型 走査型	定格出力 電圧 (1MV以上) 300kVを超え 1MV未満 100kV以上 300kV以下 表面線量 600nSv/hを超える 600nSv/h以下 100kV未満	→ [2] → エックス線等装置 特定電子顕微鏡 → エックス線等装置 特定電子顕微鏡 → 粒子加速装置 低圧電子顕微鏡 → 管理対象外 (自主管理)	放射線装置 荷電粒子を加速する装置 放射線装置 荷電粒子を加速する装置 対象外	対象外 対象外
[4] ガス抜き等の検査装置 定義 エックス線管若しくはケノトロンからのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査装置		→ エックス線等装置 エックス線管などの検査を行う装置	放射線装置 ガス抜き等の検査機器	対象外
[5] 放射性同位元素装備機器 定義 放射性同位元素を装備している機器 認証機器を除く				
ガンマ線照射装置		→ 放射性同位元素装備機器 (特定RI) 放射性物質を装備している機器	放射線装置 放射性物質を装備している機器	特定RI
その他の装置 ECDガスクロマトグラフ	認証機器である表示	→ 表示付認証機器	届出不要	表示付認証機器